



**I CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE NANOTECNOLOGIA
&
IV SIMPÓSIO SOBRE
NANOBIOTECNOLOGIA
E SUAS APLICAÇÕES**

EXPEDIENTE

PRESIDENTE DA ASPEUR

Luiz Ricardo Bohrer

REITORA DA UNIVERSIDADE FEEVALE

Inajara Vargas Ramos

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

João Alcione Sganderla Figueiredo

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Alexandre Zeni

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Gladis Luisa Baptista

PRÓ-REITOR DE INOVAÇÃO

Cleber Cristiano Prodanov

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Cristina Ennes da Silva

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Cristina Ennes da Silva

Joelma Rejane Maino

EDITORA FEEVALE

Graziele Borguetto Souza

Adriana Christ Kuczynski

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

Universidade Feevale, RS, Brasil

Bibliotecária responsável: Bruna Heller - CRB 10/2348

Congresso Internacional de Nanotecnologia - CINA (1. : 2016 : Novo Hamburgo, RS)
[Anais do] I Congresso Internacional de Nanotecnologia - CINA [recurso eletrônico] ; IV Simpósio sobre Nanobiotecnologia e suas aplicações / [comissão organizadora Luciane Rosa Feksa] ... [et al]. - Novo Hamburgo : Editora Feevale, 2016.

Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader.

Modo de Acesso: <http://www.feevale.br/hotsites/cina/apresentacao>

ISSN: 2526-9232

1. Nanotecnologia - Congressos - Brasil, Região Sul.
2. Nanobiotecnologia - Congressos - Brasil, Região Sul. I. Feksa, Luciane Rosa. II. Título.

CDU 620.3(061.3)(100)

© Editora Feevale – Os textos assinados, tanto no que diz respeito à linguagem como ao conteúdo, são de inteira responsabilidade dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião da Universidade Feevale. É permitido citar parte dos textos sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A violação dos direitos do autor (Lei n.º 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

Universidade Feevale

Câmpus I: Av. Dr. Maurício Cardoso, 510 – CEP 93510-250 – Hamburgo Velho

Câmpus II: ERS 239, 2755 – CEP 93352-000 – Vila Nova

Fone: (51) 3586.8800 – Homepage: www.feevale.br